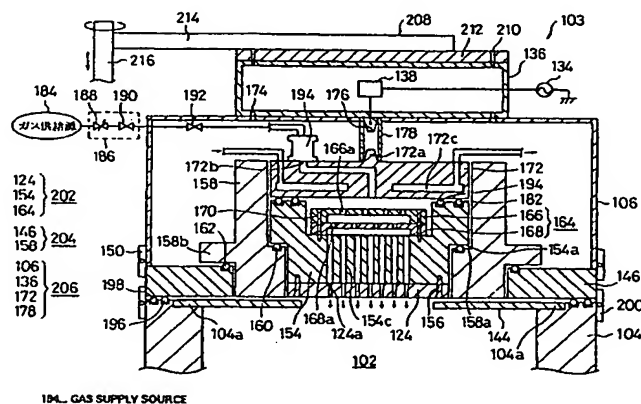




(51) 国際特許分類7 H01L 21/3065	A1	(11) 国際公開番号 WO00/60653 (43) 国際公開日 2000年10月12日(12.10.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JP00/01939 (22) 国際出願日 2000年3月29日(29.03.00) (30) 優先権データ 特願平11/88153 1999年3月30日(30.03.99) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED)[JP/JP] 〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo, (JP) (72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 廣岡隆明(HIROOKA, Takaaki)[JP/JP] 〒400-0126 山梨県中巨摩郡敷島町大下条122 カーサ ラポールティ202 Yamanashi, (JP) (74) 代理人 亀谷美明, 外(KAMEYA, Yoshiaki et al.) 〒162-0065 東京都新宿区住吉町1-12 新宿曙橋ビル Tokyo, (JP)	(81) 指定国 JP, KR, US 添付公開書類 国際調査報告書	

(54) Title: PLASMA TREATMENT DEVICE, ITS MAINTENANCE METHOD AND ITS INSTALLATION METHOD

(54) 発明の名称 プラズマ処理装置、そのメンテナンス方法およびその施工方法



104. GAS SUPPLY SOURCE

(57) Abstract

An upper electrode unit (103) which the upper wall of the treatment chamber (102) of an etching device (100), and forms which comprises a first assembly (202) including an upper electrode (124), a second assembly (204) supporting the first assembly (202) and a third assembly (206) including power supply routes (178 and 172). After a second locking mechanism (150) is released and the third assembly (206) is independently removed by a removing mechanism (208), the first assembly (202) is removed and the maintenance of the upper electrode (124) is practiced. After the second locking mechanism (150) is fixed and a first locking mechanism (200) is released, the second and third assemblies (204 and 206) are removed by the removing mechanism (208) and the inside of the treatment chamber (102) is opened for maintenance. By this construction, a plasma treatment device and its maintenance method which facilitate maintenance and relieve a worker from a heavy burden can be provided.

エッチング装置100の処理室102の上部壁を形成する上部電極ユニット103は、上部電極124を含む第1アセンブリ202と、第1アセンブリ202を支持する第2アセンブリ204と、電力供給経路178、172を含む第3アセンブリ206から構成される。第2ロック機構150を解除し、取り外し機構208により第3アセンブリ206を単独で取り外した後、第1アセンブリ202を取り外し、上部電極124のメンテナンスを行う。第2ロック機構150を固定し、第1ロック機構200を解除した後、取り外し機構208により第2および第3アセンブリ204、206を取り外し、処理室102内を開放してメンテナンスを行う。かかる構成により、メンテナンスを容易に行え作業者の負担を軽減することが可能なプラズマ処理装置およびそのメンテナンス方法が提供される。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦	DM ドミニカ	KZ カザフスタン	RU ロシア
AG アンティグア・バーブーダ	DZ アルジェリア	LC セントルシア	SD スーダン
AL アルバニア	EE エストニア	LI リヒテンシュタイン	SE スウェーデン
AM アルメニア	ES スペイン	LK スリ・ランカ	SG シンガポール
AT オーストリア	FI フィンランド	LR リベリア	SI スロヴェニア
AU オーストラリア	FR フランス	LS レソト	SK スロヴァキア
AZ アゼルバイジャン	GA ガボン	LT リトアニア	SL シェラ・レオネ
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB 英国	LU ルクセンブルグ	SN セネガル
BB バルバドス	GD グレナダ	LV ラトヴィア	SZ スワジランド
BE ベルギー	GE グルジア	MA モロッコ	TD チャード
BF ブルキナ・ファソ	GH ガーナ	MC モナコ	TG トーゴ
BG ブルガリア	GM ガンビア	MD モルドヴァ	TJ タジキスタン
BJ ベナン	GN キニア	MG マダガスカル	TM トルクメニスタン
BR ブラジル	GR キリシャ	MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR トルコ
BY ベラルーシ	GW キニア・ビサオ	共和国	TT トリニダッド・トバゴ
CA カナダ	HR クロアチア	マリ	TZ タンザニア
CF 中央アフリカ	HU ハンガリー	ML モンゴル	UA ウクライナ
CG コンゴ	ID インドネシア	MN モーリタニア	UG ウガンダ
CH スイス	IE アイルランド	MR マラウイ	US 米国
CI コートジボアール	IL イスラエル	MW メキシコ	UZ ウズベキスタン
CM カメルーン	IN インド	MX モザンビーク	VN ヴェトナム
CN 中国	IS アイスランド	MZ ニジェール	YU ユーゴスラヴィア
CR コスタ・リカ	IT イタリア	NE ノールウェー	ZA 南アフリカ共和国
CU キューバ	JP 日本	NL オランダ	ZW ジンバブエ
CY キプロス	KE ケニア	NO ノーウェー	
CZ チェッコ	KG キルギスタン	NZ ニュー・ジーランド	
DE ドイツ	KP 北朝鮮	PL ポーランド	
DK デンマーク	KR 韓国	PT ポルトガル	
		RO ルーマニア	